

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公開番号】特開2007-250568(P2007-250568A)

【公開日】平成19年9月27日(2007.9.27)

【年通号数】公開・登録公報2007-037

【出願番号】特願2006-67733(P2006-67733)

【国際特許分類】

H 01 L 21/31 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/31 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月24日(2008.12.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被処理体を収容する処理容器と、この処理容器内で被処理体に所定の処理を施す処理機構と、前記処理容器の上部に開閉可能に設けられた蓋体と、蓋体を開閉する開閉機構とを具備し、

前記開閉機構は、前記処理容器の一方の端部に蓋体を回動可能に連結するヒンジ部と、前記蓋体を回動させる駆動部とを有し、

前記ヒンジ部は、前記駆動部によって前記蓋体を回動させる際の回動軸となる主軸と、前記主軸の先端側に設けられ、蓋体の角度調整が可能な調整軸とを有することを特徴とする処理装置。

【請求項2】

前記ヒンジ部は、前記調整軸を軸として前記蓋体を回動させることにより前記蓋体の位置を調節する位置調節部を有していることを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項3】

前記位置調節部は、前記蓋体の上下方向の位置も調節可能であることを特徴とする請求項2に記載の処理装置。

【請求項4】

前記蓋体と前記処理容器との間にシール部材が介在されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項5】

前記処理機構による処理は、前記処理容器内を真空にして行われることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の処理装置。

【請求項6】

前記処理機構は、マイクロ波を発生するマイクロ波発生部と、前記蓋体に設けられ、前記マイクロ波発生部で発生したマイクロ波を前記処理容器に導くアンテナと、前記処理容器内に処理ガスを導入する処理ガス導入機構とを有し、前記マイクロ波により前記処理容器内に処理ガスのプラズマを形成することを特徴とする請求項5に記載の処理装置。

【請求項7】

被処理体を収容する処理容器内で被処理体に所定の処理を施す処理装置において、前記処理容器の上に設けられる蓋体を開閉する蓋体の開閉機構であって、

前記処理容器の一方の端部に蓋体を回動可能に連結するヒンジ部と、前記蓋体を回動させる駆動部とを有し、

前記ヒンジ部は、前記駆動部によって前記蓋体を回動させる際の回動軸となる主軸と、前記主軸の先端側に設けられ、蓋体の角度調整が可能な調整軸とを有することを特徴とする蓋体の開閉機構。

【請求項8】

前記ヒンジ部は、前記調整軸を軸として前記蓋体を回動させることにより前記蓋体の位置を調節する位置調節部を有していることを特徴とする請求項7に記載の蓋体の開閉機構。

【請求項9】

前記位置調節部は、前記蓋体の上下方向の位置も調節可能であることを特徴とする請求項8に記載の蓋体の開閉機構。